(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 12 mai 2005 (12.05.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/041983 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷:
 A61K 31/7004
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/002794

(22) Date de dépôt international :

29 octobre 2004 (29.10.2004)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication:

français

- (30) Données relatives à la priorité : 0312798 31 octobre 2003 (31.10.2003) FR
- (71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US): PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE [FR/FR]; 45, place Abel Gance, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR). CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) [FR/FR]; 3, rue Michel-Ange, F-75016 Paris (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): HOUL-MONT, Jean-Philippe [FR/FR]; 87, chemin de la Salade Ponsan, Bât A Apt 66, F-31400 Toulouse (FR). RICO-LATTES, Isabelle [FR/FR]; 118, allée de Pierras, F-31650 Auzielle (FR). PEREZ, Emile [FR/FR]; 17, allée d'Aspin, F-31770 Colomiers (FR). BORDAT, Pascal [FR/FR]; 2, chemin de l'Eglise, F-31320 Mervilla (FR).

- (74) Mandataires: MARTIN, Jean-Jacques etc.; Cabinet Regimbeau, 20, rue de Chazelles, F-75847 Paris Cedex 17 (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Déclaration en vertu de la règle 4.17 :

 relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17.iv)) pour US seulement

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont recues

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: MEDICAMENT COMPRISING A REDUCING ALKYL-SUGAR MONOMER FOR THE TREATMENT OF INFLAMMATORY DISORDERS

(54) Titre: MEDICAMENT COMPRENANT UN MONOMERE D'ALKYL-SUCRE REDUCTEUR POUR LE TRAITEMENT DES DESORDRES INFLAMMATOIRES

(57) Abstract: The invention relates to a medicament comprising at least one reducing alkyl-sugar monomer having a hydroxyl function which is substituted by an alkoxy radical at C_2 - C_{40} , said medicament being preferably intended to regulate inflammatory mechanisms. The reducing sugar is preferably selected from the group containing rhamnose, fucose and glucose. The invention also relates to a cosmetic treatment method involving the topical application of a composition comprising at least one reducing alkyl-sugar monomer having a hydroxyl function which is substituted by an alkoxy radical at C_2 - C_{40} .

(57) Abrégé: La présente invention concerne un médicament comprenant au moins un monomère d'alkylsucre réducteur dont une fonction hydroxyle est substituée par un radical alkoxy en C_2 - C_{40} , ledit médicament est avantageusement destiné à réguler les mécanismes inflammatoires. Le sucre réducteur est avantageusement choisi dans le groupe constitué par le rhamnose, le fucose et le glucose. Elle concerne également une méthode de traitement cosmétique par application topique d'une composition comprenant au moins un monomère d'alkyl-sucre réducteur, dont une fonction hydroxyle est substituée par un radical alkoxy en C_2 - C_{40} .

